

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-258219

(43)Date of publication of application : 03.10.1997

(51)Int.Cl. G02F 1/1335
G02F 1/1333
G02F 1/137

(21)Application number : 08-070789

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing : 26.03.1996

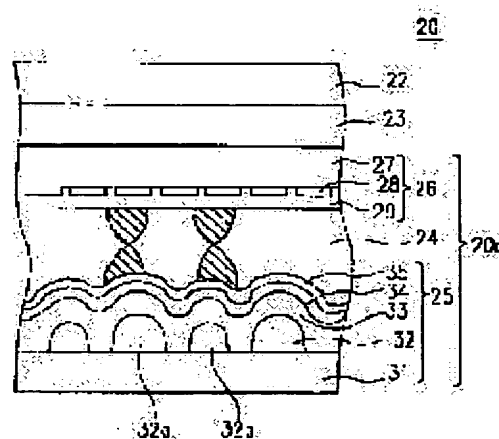
(72)Inventor : NAKAMURA KOZO
TSUDA KAZUHIKO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display device having an excellent contrast characteristic and paper white characteristic by providing a surface for reflecting the light of a reflection layer with ruggedness and specifying the ratio of the area of the region having the angle below a specified value of inclination of the tangent of the ruggedness to the surface to the area of the substrates to be in a specified range.

SOLUTION: The reflection type LCD 20 has a polarizing plate 22, a phase difference plate 23 and a liquid crystal cell 20a in this order. The liquid crystal cell 20a has the upper substrate 26, the lower substrate (reflection substrate) 25 and the liquid crystal layer 24 held between the upper substrate 26 and the lower substrate 25. The lower substrate 25 has plural projecting parts 32, high-polymer resin layers 33 covering these projecting parts 32, the reflection layer 34 and an oriented film 35 in this order on the surface of the transparent substrate 31 on the liquid crystal layer 24 side. The reflection plate and polarizing plate 22 of the device are disposed on the different sides of the liquid crystal layer. The surface which reflects light of the reflection layer 34 has the ruggedness and the ratio of the area of the region having $<2^\circ$ angle of inclination of the tangent of the ruggedness to the surface to the area of the substrate is 20 to 60%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]	3294988
[Date of registration]	05.04.2002
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]	
[Date of extinction of right]	

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

[Claim(s)]

[Claim(s)]

[Claim 1] It is the liquid crystal display which has the liquid crystal layer ****(ed) between the substrate of a pair, and the substrate of this pair, one polarizing plate, and a reflecting layer. This reflecting layer and this polarizing plate The ratio to the area of this substrate of the area of the field whenever [tilt-angle / of a tangent / as opposed to / it is prepared in the side from which this liquid crystal layer differs, and the field in which this reflecting layer reflects light has irregularity, and / this irregularity / whose] is less than 2 degrees is 20% or more liquid crystal display it is [liquid crystal display] 60% or less.

[Claim 2] This liquid crystal layer is a liquid crystal display according to claim 1 driven in electric field effect birefringence mode.

[Claim 3] The liquid crystal display according to claim 1 or 2 whose difference of the retardation of said liquid crystal layer by said irregularity is 40nm or less.

[Claim 4] A liquid crystal display given in either of claims 1-3 whose difference of the thickness of said liquid crystal layer by said irregularity is 1 micrometer or less.

[Claim 5] The reflecting plate whose ratio to the area of this substrate of the area of the field whenever [tilt-angle / of a tangent / as opposed to / the field in which light is reflected has irregularity and / this irregularity / whose] it is a substrate for reflecting light and is less than 2 degrees is 60% or less 20% or more.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the reflective mold liquid crystal display in electric field effect birefringence mode especially about the reflective mold liquid crystal display which displays by reflecting the polarization by which incidence was carried out with a reflecting plate.

[0002]

[Description of the Prior Art] It becomes most important in the engine performance required of the reflective mold LCD (liquid crystal display) how an ambient light is effectively utilizable. The

display mode generally used for current, the calculator, the word processor, etc. is TN method (twisted nematic) method which combined two polarizing plates and a reflecting plate.

[0003] However, by the method using such two polarizing plates, the linearly polarized light component of either of the two linearly polarized light components which intersect perpendicularly mutually [the elliptically polarized light (the circular polarization of light and the linearly polarized light are included) reflected with the reflecting plate] is absorbed with the polarizing plate arranged between a reflecting plate and a liquid crystal layer. Therefore, since there is a loss of basing-on absorption of polarizing plate light, a bright display is not obtained.

[0004] The liquid crystal display in ECB (electric-field control birefringence) mode using one polarizing plate as a display mode with which a display possible [a gradation display] and bright moreover is obtained is proposed (others [Nakamura]: 18th liquid crystal debate 3D110).

[0005] The principle of operation of the reflective mold liquid crystal display in this ECB mode is explained referring to drawing 1. Drawing 1 is the functional model Fig. of the reflective mold liquid crystal display 10 in ECB mode, and the case where (a) shows a dark condition and (b) shows bright state is shown, respectively.

[0006] The reflective mold liquid crystal display 10 in ECB mode is equipped with a polarizing plate 2, the phase contrast plate 3, the liquid crystal layer 4, and a reflecting plate 5. In the condition which shows in drawing 1 (a), since the sum of retardation $2\pi n \cdot d$ of the liquid crystal layer 4 and the phase contrast plate 3 is set as $\lambda/4$, the linearly polarized light which carried out incidence and penetrated the polarizing plate 2 as shown in the arrow mark A1 will turn into the circular polarization of light of the hand of cut shown in the arrow mark A2, if the liquid crystal layer 4 and the phase contrast plate 3 are passed. It is reflected by the reflecting plate 5, and this circular polarization of light turns into the circular polarization of light of the circumference of reverse with an arrow mark A 2-way, as shown in arrow mark A3. If the circumference circular polarization of light of this reverse passes the liquid crystal layer 4 and the phase contrast plate 3, the linearly polarized light at the time of incidence will turn into the linearly polarized light from which the 90 degrees of the polarization directions differ. Therefore, since this linearly polarized light cannot penetrate a polarizing plate 2, a dark condition is displayed.

[0007] On the other hand, in the condition by which it is shown in drawing 1 (b), since the sum of retardation $2\pi n \cdot d$ of the liquid crystal layer 4

and the phase contrast plate 3 is set as 0, even if the linearly polarized light which penetrated the polarizing plate 2 passes the liquid crystal layer 4 and the phase contrast plate 3, a polarization condition is maintained. Even if this linearly polarized light is depended and reflected by the reflecting plate 5, a polarization condition does not change. Therefore, since the reflected linearly polarized light is maintaining the polarization direction when carrying out incidence, it penetrates a polarizing plate 2. Consequently, bright state is displayed. The value of the sum of retardation $\delta_{\text{tan-d}}$ of the liquid crystal layer 4 and the phase contrast plate 3 is controlled by changing the retardation value of a liquid crystal layer by impressing an electrical potential difference to the liquid crystal layer 4. Thus, the reflective mold liquid crystal display in ECB mode can realize a display.

[0008] JP,7-218906,A is indicating the reflective mold liquid crystal display whose contrast property improved by having the reflecting plate maintained good, even after the polarization condition of the polarization which carried out incidence reflecting. According to the above-mentioned official report, it is made desirable to use the reflecting plate with which the degree of polarization of the reflected light expressed with the stokes parameter becomes 50% or more.

[0009]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, there were the following problems in a Prior art.

[0010] Generally, since a reflective mold liquid crystal display uses the ambient light which carries out incidence to a liquid crystal panel, as for the reflection factor of a reflecting plate, it is desirable [a liquid crystal display] that it is high as much as possible over the large range. However, when the metal membrane which has a mirror plane is used, a reflection factor becomes high only in the direction of specular reflection, an observer's face is reflected to the screen or there is a problem of being very dark, except the direction of specular reflection.

[0011] On the other hand, there is a standard white plate of MgO powder as a reflecting plate excellent in paper White nature. However, since a standard white plate has too strong diffusibility, it is excellent in paper White nature, but when it combines with a liquid crystal layer, a multiple echo happens and it has the problem of being as contrast being low **** [, and] . [shutting / light / up into a liquid crystal layer and being dark]

[0012] Moreover, since, as for the liquid crystal display in ECB mode using the reflective substrate currently indicated by above-mentioned

JP,7-218906,A, optimization of a display property is not performed, although contrast is high, there is a problem that paper White nature is inferior.

[0013] The place which it is made in order that this invention may solve the above-mentioned technical problem, and is made into the purpose is to offer a reflective mold liquid crystal display and a reflecting plate excellent in a contrast property and paper White nature.

[0014]

[Means for Solving the Problem] The liquid crystal display of this invention is a liquid crystal display which has the liquid crystal layer ****(ed) between the substrate of a pair, and the substrate of this pair, one polarizing plate, and a reflecting layer. This reflecting plate and this polarizing plate It is prepared in the side from which this liquid crystal layer differs, and the field in which this reflecting layer reflects light has irregularity, the ratio to the area of this substrate of the area of the field whenever [tilt-angle / of the tangent to the front face of this irregularity / whose] is less than 2 degrees is 60% or less 20% or more, and the above-mentioned purpose is attained by that.

[0015] As for this liquid crystal layer, it is desirable to drive in electric field effect birefringence mode.

[0016] It is desirable that the difference of the retardation of said liquid crystal layer by said irregularity is 40nm or less.

[0017] It is desirable that the difference of the thickness of said liquid crystal layer by said irregularity is 1 micrometer or less.

[0018] The reflecting plate by this invention is a substrate for reflecting light, the field in which light is reflected has irregularity, the ratio to the area of this substrate of the area of the field whenever [tilt-angle / of the tangent to this irregularity / whose] is less than 2 degrees is 60% or less 20% or more, and the above-mentioned purpose is attained by that.

[0019] The reflective substrate of this invention has the reflector which has irregularity, and the ratio [as opposed to the area of a substrate in the area of the flat part whenever / tilt-angle / of a tangent / as opposed to irregularity in this reflector / whose / is less than 2 degrees] has become 60% or less 20% or more. This flat part contributes to improvement in contrast, and concave heights contribute to improvement in paper White nature. Consequently, the reflective mold liquid crystal display excellent in a contrast property and paper White nature can be offered.

[0020] Furthermore, while being able to attain the practical contrast 3 by setting a changed part of the retardation of the liquid crystal layer by irregularity to 40nm or less, high color display can be performed to color purity using the interference

color in ECB mode.

[0021] Moreover, even if it uses the liquid crystal layer of the STN orientation where a torsion angle is large by setting the difference of the thickness of the liquid crystal layer by irregularity as 1 micrometer or less, a liquid crystal display without deterioration of the display quality by dispersion in a threshold property can be offered.

[0022]

[Embodiment of the Invention] Below, the gestalt of operation of this invention is explained.

[0023] (Basic configuration of the reflective mold liquid crystal display in ECB mode) The sectional view of the reflective mold liquid crystal display (reflective mold LCD) 20 in the ECB mode by this invention is shown in drawing 2. This example explains the liquid crystal display of the STN (Spa twisted pneumatic) mold by which a simple MATORIKU drive is carried out.

[0024] This reflective mold LCD 20 has a polarizing plate 22, the phase contrast plate 23, and liquid crystal cell 20a in this order from the incidence side of light. Liquid crystal cell 20a has the liquid crystal layer 24 ****(ed) by the up substrate 26, the lower substrate (reflective substrate) 25, and the up substrate 26 and the lower substrate 25. The up substrate 24 has a transparent electrode 28 and the orientation film 29 in this order in the field by the side of the liquid crystal layer 24 of the transparence substrate 27 and the transparence substrate 27. Moreover, the lower substrate 25 has the wrap macromolecule resin layer 33, a reflecting layer 34, and the orientation film 35 for two or more heights 32 and a height 32 in this order in the field by the side of the liquid crystal layer 24 of the transparence substrate 31. The height 32 has large height 32a and small height 32b from which height differs mutually.

[0025] In this example, the reflecting layer 34 is formed with aluminum and functions also as an electrode. A reflecting layer 34 and a transparent electrode 28 are electrodes arranged in the shape of a stripe, respectively, intersect perpendicularly mutually through a solution layer 24, and, as for a reflecting layer 34 and a transparent electrode 28, form a MATORIKU-like picture element. As a liquid crystal layer 24, the liquid crystal ingredient for STN (for example, trade name ZLI4427 by Merck Co.) is used. This reflective type LCD 20 of a polarizing plate 22, the phase contrast plate 23, the liquid crystal layer 24, and a reflecting layer 34 function as the polarizing plate 2, the phase contrast plate 3, the liquid crystal layer 4, and reflecting plate 5 of drawing 1, respectively. The phase contrast plate 23 is omissible by using the liquid crystal layer from which a retardation changes between $\lambda/4$

and 0 as a liquid crystal layer 24. Since the wavelength dispersion of the reflected light can be reduced by forming the phase contrast plate 23, the high display of color purity is attained. Moreover, the display of a wide-field-of-view angle can be offered by compensating the viewing-angle dependency resulting from the orientation of the liquid crystal molecule of the liquid crystal layer 24 with the phase contrast plate 23.

[0026] The ingredient of a reflecting layer 34 is not restricted to aluminum, but other metallic materials can also be used for it, and when forming the reflecting layer which does not have conductivity, it may form a transparent electrode in the top face of a reflecting layer separately. Moreover, the orientation condition of a liquid crystal layer is not restricted to a STN mold, but can use widely the liquid crystal layer from which a retardation changes with impression of electric field.

[0027] Next, the lower substrate 25 is explained, referring to drawing 3 and 4. Drawing 3 is the plan of the lower substrate 25. A large number formation of large height 31a and small height 31b to which the lower substrate 25 consists of resin on the transparence substrate 31 is carried out, respectively. The substrate with which the diameters D1 and D2 in the pars basilaris ossis occipitalis (front face of a substrate 31) of large height 32a and small height 32b differ from the spacing D3 of a height is produced. As for D1 and D2, it is desirable that it is in the range of about 3 to 20 micrometers. If smaller than about 3 micrometers, processing by the photolithography will become difficult. Moreover, if about 20 micrometers is exceeded, the height of heights will become high, and the effect which it has on cell thickness becomes large. D3 is set up so that the rate of surface ratio of the flat part mentioned later may serve as suitable range. For example, the rate of flat part area can be made about 70% by making D3 into the abbreviation 1/3 of D1 and D2. In addition, since the diameter of a height becomes large by heat-treating a height so that it may mention later, the lower limit of D3 becomes small and is set to about 1.5 micrometers from the lower limit decided by the photolithography.

[0028] Drawing 4 is a sectional view which explains like the manufacture line of the lower substrate 25. As a transparence substrate 31, thickness t1 used the glass substrate (the Corning, Inc. make, trade name 7059) which is 1.1mm. it is shown in drawing 4 (a) -- as -- a glass substrate 31 top -- as an example -- Tokyo -- adaptation -- the spin coat of shrine make and the photosensitive ingredient of a trade name OFPR800 is carried out by 500r.p.m - 3000r.p.m, and the resin layer 41 is formed. In this example, a spin coat is carried out

for 30 seconds by 2500r.p.m, and thickness t_2 forms the 1.5-micrometer resin layer 41.

[0029] Next, as the substrate with which the resin layer 41 was formed is continuously calcinated [for 30 minutes] and shown in drawing 4 (b) in a 90-degree C ambient atmosphere, the photo mask 42 with which much circular protection-from-light section of two kinds of size 42a was formed is arranged and exposed. then -- as an example -- Tokyo -- adaptation -- negatives were developed with the developer which consists of shrine make and a 2.38% solution of trade name NMD-3, and as shown in drawing 4 (c), large projection 41a and small projection 41b from which height differs were formed in the front face of a glass substrate 31. Large projection 41a and small projection 41b from which this height differs are realizable by controlling the exposure time and developing time.

[0030] In addition, a photo mask 42 is a configuration arranged at random in the circular protection-from-light section 42 from which the array condition of large projection 41a shown in drawing 3 and small projection 41b is acquired. Although the diameter of the protection-from-light section of a photo mask 42 showed the example established so that it may correspond to the diameter of large projection 41a and small projection 41b to drawing 4 (b), it needs to set up the pattern (D1, D2, and D3) of a mask in consideration of extent of deformation by melting in the heat treatment process of drawing 4 (d) explained later. Typically, the diameters D1 and D2 of Heights 32a and 32b increase about twenty percent from about 1 rather than the diameter of the protection-from-light section of a photo mask according to the deformation (heat whom) by heat treatment. Moreover, you may form by forming and performing a photolithography process twice at one photolithography process, using the photo mask of two sheets which has the protection-from-light section of magnitude different, respectively using the photo mask 42 which has protection-from-light section 42a of magnitude which is different in the height heights of different height as shown in drawing 4 (b). here -- D -- 1 = about 10 micrometers and D -- 2 = about 8 micrometers and D -- the case of 3 = about 2 micrometers is shown.

[0031] Next, the glass substrate 31 with which large projection 41a and small projection 41b were formed was heated at 200 degrees C for 1 hour, as shown in drawing 4 (d), extent fusion of the crowning of Projections 41a and 41b was carried out a little, and it was made the shape of radii, and large height 32a and small height 32b were formed.

[0032] Next, on the glass substrate 31 of this condition, as shown in drawing 4 R> 4 (e), the spin

coat of the same ingredient as said photopolymer ingredient is carried out by 1000r.p.m - 3000r.p.m. At this example, a spin coat is carried out by suitable 2000r.p.m. Thereby, the hollow between each projections 32a and 32b is filled, the front face of the macromolecule resin layer 33 is comparatively quiet, and it is formed in the condition of carrying out the shape of a smooth surface. Although the same resin as said photopolymer ingredient was applied in this example, the thing of a different class may be used. In addition, the thickness t_4 of a smooth large projection formed in the front face of the macromolecule resin layer 33 of large height 32a was about 1 micrometer, and the thickness t_5 of a smooth small projection formed of small height 32b was about 0.3 micrometers. Next, metal thin films, such as aluminum, nickel, chromium, silver, or gold, are formed on the macromolecule resin layer 33 at the about thickness t_3 , for example, 0.01-1.0 micrometers. In this example, sputtering of the aluminum is carried out and a reflecting layer 34 is formed. Thus, the microphotography of the front face of the obtained reflective substrate 60 is shown in drawing 6 R> 6. Moreover, the microphotography of the reflective substrate 70 obtained by performing 2 times of photolithography processes is shown in drawing 7 using the photo mask which has the circular protection-from-light section with a diameter of about 10 micrometers, and the photo mask which has the circular protection-from-light section with a diameter of about 5 micrometers.

[0033] In addition, by arranging superficially large height 32a and small height 32b at random, and changing the height of large height 32a and small height 32b further, as mentioned above Since the flat part which gives the same phase contrast to incident light can be lessened, it becomes possible to prevent that the light reflected by the reflecting layer 34 interferes, and the interference color and a striped pattern occur, and it is uniform and the high display of color purity can be performed. In addition, the pattern of a photo mask 42 may not be limited to the above-mentioned example, but the configuration except circular is sufficient as it.

[0034] The following processings are performed to the lower substrate 25 produced as mentioned above and the up substrate 26 produced by the well-known approach. First, the orientation film 29 and 35 which consists of polyimide resin is formed on [each] the up substrate 26 and the lower substrate 25, and it calcinates at 220 degrees C for 1 hour. In this example, the Nissan chemistry company make and trade name SANEB A 150 were used. Next, rubbing processing for carrying out orientation of the liquid crystal

molecule of the liquid crystal layer 24 is performed. Thereby, the final orientation film 29 and 35 is formed.

[0035] Next, the above-mentioned glass substrate 31 and the sealing compound which closes between 27 are formed by screen-stenciling an adhesive sealant.

[0036] Thus, it faces sticking the lower substrate 25 and the up substrate 26 which were formed, a spacer with a diameter of 5.5 micrometers is sprinkled to the lower substrate 25, and thickness of the liquid crystal layer 24 is regulated. Then, after countering and sticking the lower substrate 25 and the up substrate 26 by said sealant (the spacer with a diameter of 6 micrometers was mixed as an example), the liquid crystal layer 24 is formed by carrying out vacuum impregnation of the liquid crystal ingredient between the lower substrate 25 and the up substrate 26. In this example, the liquid crystal layer 34 is formed using the pneumatic liquid crystal (the Merck Co. make, the trade name ZLI4427 as an example) twisted 240 degrees between the lower substrate 25 and the up substrate 26.

[0037] The shape of surface type of a reflecting layer 33 is controlled, and the reflective mold LCD of this invention has the outstanding paper White nature and contrast so that it may mention later. Below, the configuration of the reflective substrate (lower substrate) by this invention is explained at a detail.

[0038] (Area of the flat part of a reflective substrate) The various reflective substrates with which surface configurations differ were produced using the approach mentioned above. The above-mentioned reflective mold liquid crystal display was produced using the obtained reflective substrate, and contrast and paper White nature were evaluated.

[0039] The area of a flat part was used as an index showing the shape of surface type of a reflective substrate. As mentioned above, although the reflecting plate which has a mirror plane realizes high contrast only in the direction of specular reflection, it is inferior to paper White nature. On the other hand, although a standard white plate is excellent in paper White nature, it is dark and its contrast is low. The cause of producing the difference in this reflection property thought that it was in the difference in the shape of surface type of a specular reflection plate and a standard white plate, and thought that the difference among those configurations could be expressed as a rate of area of a flat part. 100% of rates of flat part area and a standard white plate are expressed for a mirror plane as 0% of rates of flat part area.

[0040] The evaluation approach of the rate of area

of the flat part of a reflective substrate is explained referring to drawing 5 R> 5. Drawing 5 (a) is drawing showing typically the shape of surface type of the reflective substrate 50, and drawing 5 (b) is drawing showing theta whenever [tilt-angle / which is called for from a surface profile]. In addition, the following observation and the evaluations are performed in the condition that the reflector which consists of aluminum is exposed to the front face of a reflective substrate.

[0041] First, the front face of the reflective substrate 50 is observed using an interference microscope. The surface profile 52 shown in drawing 5 (b) is obtained by scanning the visual field core of a microscope along with the scanning line 51 of drawing 5 (a) so that it may pass through the summit of the heights of the front face of the reflective substrate 50. The axis of abscissa of drawing 5 (b) expresses the location of substrate side inboard, and an axis of ordinate expresses concavo-convex height, respectively. Next, a tangent 53 is drawn to the irregularity of this surface profile 52. The angle of this tangent 53 and a substrate side (flat surface specified by the two-dimensional direction of breadth of a reflective substrate) to accomplish is defined as the tilt angle theta. In substrate side inboard, at the fixed spacing X_0 , a tangent is drawn to irregularity and it asks for the tilt angle theta, respectively. This tilt angle theta defines a less than 2-degree point as a flat part. Typically, about 100 points which measure the tilt angle theta are measured to one heights by every about 0.1 micrometers. ($X_0 =$ about 0.1 micrometers). Whenever [tilt-angle], measurement of theta may measure the surface profile of the whole 1 picture element, may choose suitably the field which has a criteria-profile and may measure it only about the field. Since the production approach of the reflective substrate mentioned above can form irregularity with sufficient repeatability, if the field which has a criteria-profile is sampled, it does not need to measure the surface profile of the whole 1 picture element. Thus, whenever [tilt-angle / which was obtained], from the measurement result of theta, when theta divided the number of less than 2-degree point of measurement by the number of all point of measurement whenever [tilt-angle], the rate of flat part area was computed.

[0042] The example of a reflective substrate is shown in drawing 6 and drawing 7. Drawing 6 (a) and drawing 7 (a) are the optical microscope photographs of the reflector of a reflective substrate, and drawing 6 (b) and drawing 7 (b) are histograms which show the result of having evaluated each surface profile. The rate of flat

part area of the reflective substrate 60 of drawing 6 (part of the gray in drawing) was about 40%, and the rate of flat part area of the reflective substrate 70 of drawing 7 (white part in drawing) was about 12%. In addition, each microphotography is the result of observing a part of picture element of 166micromx256micrometer.

[0043] Using the various reflective substrates obtained as mentioned above, the above-mentioned reflective mold LCD 20 is produced, and the result of having evaluated paper White nature and contrast is shown in Table 1 and drawing 8, respectively. Performing evaluation of paper White nature visually in the section indoor two or more fluorescent lamps exist, contrast evaluated the contrast at the time of vertical incidence using the power meter.

[0044]

[Table 1]

平坦部の 占有比率	20	40	50	60	80
ペーパー ホワイト性	◎	○	○	△	×

◎ 白い
○ 白く感じる } ペーパーホワイト
△ 白っぽい
× 金属的(ミラー)な色あい、顔がうつる

[0045] Paper White nature falls as the rate of flat part area increases so that clearly from Table 1. When the rate of flat part area exceeded 80%, the phenomenon in which an observer's face was reflected to the screen was seen, and there was an impression dark on the whole. This shows that the rate of flat part area is 60% or less preferably 80% or less.

[0046] On the other hand, if the rate of flat part area becomes high so that clearly from drawing 8, contrast will tend to go up. Also in the reflective mold LCD using the substrate of 20% of rates of flat part area excellent in paper White nature, it turns out that contrast 4 is acquired. If there is 2 more than contrast of the reflective mold LCD, it can be displayed, and practical use will be presented with it if there is 3 more than contrast. The reflective mold LCD using the reflective substrate whose rate of flat part area is 20 - 60% can perform a four or more-contrast ratio high-definition display while it is excellent in paper White nature, so that these results may show.

[0047] (Relation between the concavo-convex

difference of elevation and a retardation) When the electrochromatic display using the interference color in ECB mode is constituted, there is a problem that a reflection factor and color reproduction nature (color purity) fall by dispersion in the retardation of a liquid crystal layer. Then, in the reflective substrate which has irregularity (height), the conditions for obtaining the high display of contrast and color purity were examined.

[0048] Drawing 9 is drawing showing the reflective mold LCD typically, and shows only the surface profile 92 and the liquid crystal layer 94 of a reflective substrate. The surface profile 92 can be measured using an interference microscope, as mentioned above. Since the surface profile 92 of a reflective substrate has irregularity, the thickness of the liquid crystal layer 94 has different thickness expressed with the minimum value dT (it corresponds to the top-most-vertices location of the heights of a reflective substrate), and Maximum dB (it corresponds to the bottom point location of the crevice of a reflective substrate), respectively. In addition, when the surface profile 92 of a reflective substrate has the heights from which height differs, for example like drawing 9 (a) and a liquid crystal layer has thickness dT1 and dT2, let the minimum value of these be the minimum value dT. Thus, the reflection factor of the reflective mold LCD using the effectual retardation and such a reflective substrate of the liquid crystal layer 94 which have dispersion in thickness is the following, and is made and called for.

[0049] As mentioned above, the minimum value of the thickness of the liquid crystal layer 94 is set to dT, maximum is set to dB, an auxiliary line 95 is drawn in a concavo-convex middle location (location where the thickness of the liquid crystal layer 94 becomes (dT+dB)/2), and it asks for the area carried out by the auxiliary line 95 for 2 minutes. When area of the part which is below S1 and an auxiliary line 95 about the area of the part above an auxiliary line 95 is set to S2, the reflection factor R of the reflective mold LCD is expressed with following (several 1). A expresses the amplitude of light among the following formulas, and, as for lambda, the wavelength of light and deltan express the rate of a birefringence of a liquid crystal molecule, respectively.

[0050]

[Equation 1]

$$R = \{S_1 / (S_1 + S_2)\} * A^2 \{(\cos \pi(\Delta n d_T / \lambda))^2 - (\sin \pi(\Delta n d_T / \lambda))^2\}^2 + \{S_2 / (S_1 + S_2)\} * A^2 \{(\cos \pi(\Delta n d_B / \lambda))^2 - (\sin \pi(\Delta n d_B / \lambda))^2\}^2$$

[0051] Moreover, effectual retardation deltanE of

a liquid crystal layer is expressed with following (several 2).

[0052]

[Equation 2]

$$\Delta n d_E = \{S_1 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_T + \{S_2 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_B$$

[0053] Furthermore, change part deltan (dT-dB) of the retardation resulting from the concavo-convex difference of elevation is expressed below (several 3) (it corresponds to the difference of the 2nd term of the right-hand side of the above (several 2)). In addition, regardless of a sign, especially (dT-dB) expresses an absolute value, unless it refuses.

[0054]

[Equation 3]

$$\Delta n (d_T - d_B) = \{S_1 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_T - \{S_2 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_B$$

[0055] In addition, the method of asking for an above-mentioned reflection factor and an above-mentioned retardation with a natural thing is not restricted to the reflective substrate which was shown in drawing 9 (a) and which carries out surface profile **. Like drawing 9 (b), it is applicable also to the reflective substrate with which heights were formed by the low consistency like the reflective substrate with which heights were formed in high density, and drawing 9 (c). Furthermore, it is not restricted to what also showed the configuration of the surface profile of a reflective substrate to drawing 9, but can ask for a reflection factor and a retardation about the reflective substrate which has the surface profile of various configurations. For example, it is applicable also to the reflective substrate which has the surface profile of the shape of a rectangle as shown in drawing 4 (c).

[0056] By the approach mentioned above while referring to drawing 4, the various reflective substrates with which extent of the concavo-convex difference of elevation differs were produced, and the reflective mold liquid crystal display in the ECB mode a configuration of having been shown in drawing 2 was produced using those reflective substrates. The result of having investigated the relation of the effective retardation $\Delta n d_E$ and the reflection factor which are given by (several 2) about the reflective mold LCD in the obtained ECB mode is shown in 13 from drawing 10. The axis of abscissa in the graph of 13 is the wavelength of the reflected light from the reflective mold LCD from drawing 10, and an axis of ordinate shows a reflection factor. Respectively, a result in case effective retardation $\Delta n d_E(s)$ of a liquid crystal layer expressed above (several 2) are 330nm (drawing 10 R> 0), 360nm (drawing 11), 470nm (drawing 12), and 530nm (drawing 13) is shown. Moreover, change

part deltan (dT-dB) of the retardation resulting from the concavo-convex difference of elevation shows the result in 0nm (equivalent to a specular reflection plate), 30nm, 40nm, and 50nm about each. As shown in these drawings, the electrochromatic display in ECB mode can be constituted by using for a reflection factor the phenomenon which wavelength dispersion (interference color) produces by the difference in the retardation of a liquid crystal layer.

[0057] If change part deltan (dT-dB) of the retardation by the concavo-convex difference of elevation becomes large in all whose effective retardation value $\Delta n d_E(s)$ of a liquid crystal layer are 330nm, 360nm, 470nm, and 530nm so that clearly from these drawings, the maximum permeability (crest) will fall and the minimum permeability (trough) will rise. Therefore, when the concavo-convex difference of elevation is too large, it turns out that contrast falls. Moreover, if the concavo-convex difference of elevation becomes large, since the steepness of the wavelength dependency (wavelength dispersion) of a reflection factor will fall, it turns out that the color purity of the reflected light falls.

[0058] An above-mentioned result and a result in case change part deltan (dT-dB) of the retardation by the concavo-convex difference of elevation is 10nm and 20nm are doubled, the relation of the magnitude of change part deltan (dT-dB) of a retardation and the wavelength dispersion of the reflected light by the concavo-convex difference of elevation is summarized, and it is shown in drawing 14. Drawing 14 R> 4 is the chromaticity diagram showing the wavelength dispersion of the reflected light by change part deltan (dT-dB) of the retardation resulting from the concavo-convex difference of elevation about the case where the effective retardation values of a liquid crystal layer are 330nm, 360nm, 470nm, and 530nm. In all wavelength ranges (330, 360, 470, and 530nm), signs that the chromaticity of the reflected light is approaching the flake (condition without wavelength dispersion) of a chromaticity diagram center section are known as concavo-convex extent becomes large. It turns out that color purity will fall from this if the concavo-convex difference of elevation increases, and the color reproduction nature using the interference color of color display falls.

[0059] Moreover, the relation of the change part deltan (dT-dB) of a retardation and contrast which originate in drawing 15 at the concavo-convex difference of elevation is shown. It turns out that contrast is falling as the concavo-convex difference of elevation becomes large so that clearly from drawing 15. In order to acquire the practical contrast 3 from this drawing, it is required for the

value of change part $\Delta T \cdot \Delta B$ of the retardation resulting from the concavo-convex difference of elevation to be 40nm or less, and it turns out that four or more contrast is acquired by 35nm or less. Also about that of color purity, if change part $\Delta T \cdot \Delta B$ of the retardation resulting from the concavo-convex difference of elevation is 40nm or less, if it is 35nm or less, the high display of color purity can be offered further practically satisfactory.

[0060] (Relation between the concavo-convex difference of elevation and a threshold property) With the liquid crystal display in the ECB mode shown in the above-mentioned example, if the torsion angle of the twist orientation of a liquid crystal layer is enlarged, the threshold in the electrical-potential-difference-reflection factor property will become steep. In the liquid crystal display which has a steep threshold property, dispersion in the thickness of a liquid crystal layer turns into dispersion in threshold voltage, and falls display quality.

[0061] Then, the conditions for applying to a STN mold liquid crystal display with the large torsion angle of the twist orientation of a liquid crystal layer were examined. The result as which concavo-convex difference-of-elevation $\Delta T \cdot \Delta B$ estimated the relation between the natural pitch P_0 of a liquid crystal ingredient, a ratio (d/P_0) with the cel gap (thickness of a liquid crystal layer) d , and the steepness α of a threshold property about the STN mold liquid crystal display of 240-degree twist using a reflective substrate (0 micrometer, 0.5 micrometers, and 1 micrometer), respectively is shown in drawing 16.

[0062] In addition, the ratio (V_{90}/V_{10}) of the electrical-potential-difference value V_{10} to which a relative reflection factor reaches to 10%, and the electrical-potential-difference value V_{90} which reaches to 90% defined steepness α .

[0063] For example, if it assumes applying the reflective mold LCD to a portable information terminal equipment, since it can be necessary to carry out a passive-matrix drive in 1/240 of duty ratios, as for the steepness of a threshold property, it is desirable that it is a value with the lower right lower than the border area ($\alpha =$ about 1.06 to 1.07 range) shown with the slash of ** in drawing 16. Moreover, in order to obtain the stable orientation of a liquid crystal molecule, as for d/P_0 , it is desirable that it is a value with the lower left smaller than the border area (about 0.48 to 0.51 range) shown with the slash of ** in drawing 16. It is based on the following reasons. If d/P_0 becomes larger than about 0.6, 240-degree twist orientation of a liquid crystal molecule will become unstable, it will become easy to generate a stripe domain, and, as a result, display quality

will deteriorate. Moreover, if d/P_0 becomes smaller than about 0.42, since 60-degree twist orientation will become is easy to be formed, it is not desirable. Therefore, if the stability of the orientation of a liquid crystal molecule is taken into consideration even if there is some cel thickness nonuniformity, as for the natural pitch P_0 of a liquid crystal ingredient, and the ratio (d/P_0) with the cel gap d , it is desirable that it is in about 0.48 to 0.51 range. [0064] If concavo-convex difference-of-elevation $\Delta T \cdot \Delta B$ becomes large so that clearly from drawing 16, steepness will fall (it shifts above [in drawing 16]). Therefore, in order to realize steepness and stable orientation, about 1 micrometer or less is more preferably understood that it is about 0.5 micrometers or less as extent of the concavo-convex difference of elevation. Moreover, in the STN mold liquid crystal display corresponding to the point (**, O, and \cdot) of drawing 16, neither a stripe domain nor 60-degree twist orientation was seen.

[0065] In addition, the problem of the above-mentioned threshold property is remarkable in a STN mold liquid crystal display with a large torsion angle, for example, does not pose a problem especially in the liquid crystal display in parallel orientation mode.

[0066]

[Effect of the Invention] According to this invention, it excels in paper White nature, and the high reflective mold liquid crystal display of contrast is offered. Furthermore, color purity is high and the reflective mold liquid crystal display with which **** has a threshold property is offered. These reflective mold liquid crystal displays are used for electronic equipment including a portable information terminal equipment.

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the functional model Fig. of the reflective mold liquid crystal display in ECB mode.

[Drawing 2] It is the sectional view of the reflective mold liquid crystal display 20 in the ECB mode by this invention.

[Drawing 3] It is the plan of the lower substrate 25 of the reflective mold liquid crystal display 20.

[Drawing 4] It is the sectional view which explains like the manufacture line of the lower substrate 25 of the reflective mold liquid crystal display 20.

[Drawing 5] It is drawing showing the evaluation approach of the rate of flat part area of a reflective substrate. (a) is drawing showing the shape of surface type of a reflective substrate typically, and (b) is drawing showing whenever [tilt-angle / which is called for from a surface profile].

[Drawing 6] It is drawing showing a reflective substrate substrate. (a) is the optical microscope

photograph of the reflector of a reflective substrate, and (b) is a histogram which shows the result of having evaluated each surface profile.

[Drawing 7] It is drawing showing a reflective substrate, and (a) is the optical microscope photograph of the reflector of a reflective substrate, and (b) is a histogram which shows the result of having evaluated each surface profile.

[Drawing 8] It is drawing showing the relation between the rate of flat part area of a reflective mold liquid crystal display, and contrast.

[Drawing 9] It is drawing showing a reflective mold liquid crystal display typically.

[Drawing 10] It is the graph which shows the relation between the effective retardation of a liquid crystal layer, and a reflection factor.

[Drawing 11] It is the graph which shows the relation between the effective retardation of a liquid crystal layer, and a reflection factor.

[Drawing 12] It is the graph which shows the relation between the effective retardation of a liquid crystal layer, and a reflection factor.

[Drawing 13] It is the graph which shows the relation between the effective retardation of a liquid crystal layer, and a reflection factor.

[Drawing 14] It is the chromaticity diagram showing the wavelength dispersion of the reflected light by the reflective substrate with which the concavo-convex differences of elevation differ.

[Drawing 15] It is the graph which shows the relation between the difference of elevation of the irregularity of a reflective substrate, and contrast.

[Drawing 16] It is drawing showing the relation between the natural pitch P_0 of a liquid crystal ingredient, a ratio (d/P_0) with the cell gap d , and the steepness α of a threshold property.

[Description of Notations]

2 Polarizing Plate

3 Phase Contrast Plate

4 Liquid Crystal Layer

5 Reflecting Plate

10 Reflective Mold Liquid Crystal Display in ECB Mode

20 Reflective Mold LCD

20a Liquid crystal cell

22 Polarizing Plate

23 Phase Contrast Plate

24 Liquid Crystal Layer

25 Lower Substrate (Reflective Substrate)

26 Up Substrate

27 Transparence Substrate

28 Transparent Electrode

29 35 Orientation film

31 Transparence Substrate

32 Height

32a Large height

32b Small height

33 Macromolecule Resin Layer

34 Reflecting Layer (Reflector)

41 Resin Layer

41a Large projection

41b Small projection

42 Photo Mask

42a Protection from light section

50 Reflective Substrate

51 Scanning Line

52 Surface Profile

53 Tangent

92 Surface Profile

94 Liquid Crystal Layer

95 Auxiliary Line

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-258219

(43) 公開日 平成9年(1997)10月3日

(51)Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	F I		技術表示箇所
G 0 2 F	1/1335	5 2 0		G 0 2 F	1/1335	5 2 0
	1/1333	5 0 0			1/1333	5 0 0
	1/137				1/137	

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平8-70789

(22) 出願日 平成8年(1996)3月26日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 中村 浩三

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72) 発明者 津田 和彦

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

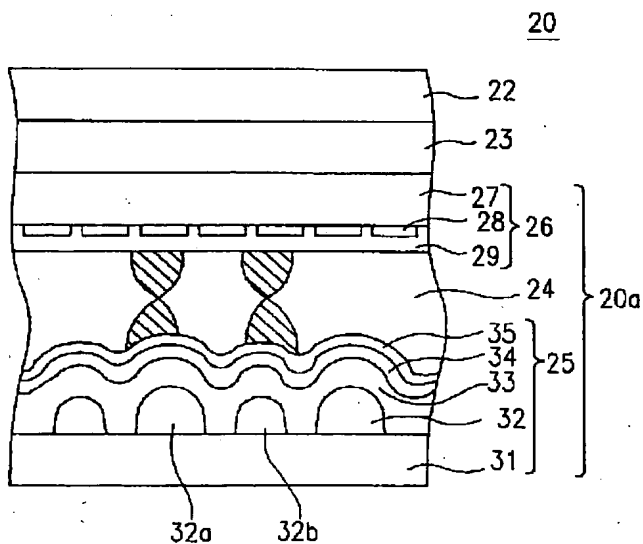
(74) 代理人 弁理士 山本 秀策

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 コントラスト特性、ペーパーホワイト性に優れた反射型液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 一対の基板と、該一対の基板の間に挟持された液晶層と、一枚の偏光板と、反射層とを有する液晶表示装置であって、該反射層と該偏光板とは、該液晶層の異なる側に設けられ、該反射層は、光を反射する面が凹凸を有し、該凹凸の表面に対する接線の傾斜角度が2°未満である領域の該基板の面積に対する比率が20%以上60%以下である液晶表示装置。



(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一对の基板と、該一对の基板の間に挟持された液晶層と、一枚の偏光板と、反射層とを有する液晶表示装置であって、
該反射層と該偏光板とは、該液晶層の異なる側に設けられ、
該反射層は、光を反射する面が凹凸を有し、該凹凸に対する接線の傾斜角度が 2° 未満である領域の面積の該基板の面積に対する比率が20%以上60%以下である、
液晶表示装置。

【請求項2】 該液晶層は、電界効果複屈折モードで駆動される請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記凹凸による前記液晶層のリタレーションの差が40nm以下である、請求項1または2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記凹凸による前記液晶層の厚さの差が $1\mu\text{m}$ 以下である、請求項1から3のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項5】 光を反射するための基板であって、
光を反射する面が凹凸を有し、該凹凸に対する接線の傾斜角度が 2° 未満である領域の面積の該基板の面積に対する比率が20%以上60%以下である反射板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、入射された偏光を反射板で反射することによって表示を行う反射型液晶表示装置に関し、特に、電界効果複屈折モードの反射型液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】反射型LCD（液晶表示装置）に要求される性能の中で最も重要となるのは、周囲光をいかに有効に活用できるかどうかである。現在、電卓、ワープロ等に一般に用いられている表示モードは、2枚の偏光板と、反射板とを組み合わせたTN方式（ツイステッドネマティック）方式である。

【0003】ところが、このような偏光板を2枚用いる方式では、反射板で反射された楕円偏光（円偏光及び直線偏光を含む）の互いに直交する2つの直線偏光成分の内のいずれか一方の直線偏光成分が、反射板と液晶層との間に配置された偏光板によって吸収される。従って、偏光板の吸収による光のロスがあるので、明るい表示が得られない。

【0004】階調表示が可能でしかも明るい表示が得られる表示モードとして、1枚の偏光板を用いたECB（電界制御複屈折）モードの液晶表示装置が提案されている（中村ほか：第18回液晶討論会3D110）。

【0005】このECBモードの反射型液晶表示装置の動作原理を図1を参照しながら説明する。図1は、ECBモードの反射型液晶表示装置10の機能モデル図であり、（a）は暗状態を、（b）は明状態を表示している

2

場合をそれぞれ示す。

【0006】ECBモードの反射型液晶表示装置10は、偏光板2、位相差板3、液晶層4、及び反射板5とを備える。図1（a）に示す状態では、液晶層4と位相差板3とのリタレーション $\Delta n \cdot d$ の和が $\lambda/4$ に設定されているので、矢符A1に示すように入射し偏光板2を透過した直線偏光は、液晶層4及び位相差板3を通過すると、矢符A2に示す回転方向の円偏光となる。この円偏光は、反射板5によって反射され、矢符A3に示すように、矢符A2方向とは逆回りの円偏光となる。この逆回り円偏光は、液晶層4と位相差板3とを通過すると、入射時の直線偏光とは偏光方向が 90° 異なる直線偏光となる。従って、この直線偏光は偏光板2を透過できないので、暗状態が表示される。

【0007】一方、図1（b）に示される状態では、液晶層4と位相差板3とのリタレーション $\Delta n \cdot d$ の和が0に設定されているので、偏光板2を透過した直線偏光は、液晶層4及び位相差板3を通過しても偏光状態が維持される。この直線偏光は、反射板5による反射されても偏光状態が変化しない。従って、反射された直線偏光は、入射したときの偏光方向を維持しているので、偏光板2を透過する。その結果、明状態が表示される。液晶層4と位相差板3とのリタレーション $\Delta n \cdot d$ の和の値は、液晶層4に電圧を印加することによって、液晶層のリタレーション値を変化させることによって制御される。このようにして、ECBモードの反射型液晶表示装置は、表示を実現することができる。

【0008】特開平7-218906号公報は、入射した偏光の偏光状態が反射後も良好に維持する反射板を備えることによって、コントラスト特性が向上した反射型液晶表示装置を開示している。上記公報によると、ストークスパラメータで表した反射光の偏光度が50%以上となる反射板を用いることが好ましいとされている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の技術では、以下のような問題があった。

【0010】一般に、反射型液晶表示装置は、液晶パネルに入射する周辺光を利用するので、反射板の反射率は広い範囲にわたってできるだけ高いことが好ましい。しかしながら、鏡面を有する金属膜を用いると、正反射方向でのみ反射率が高くなり、観察者の顔が表示面に写ったり、正反射方向以外では大変暗いという問題がある。

【0011】一方、ペーパーホワイト性に優れた反射板としては、MgO粉末の標準白色板がある。しかしながら、標準白色板は、拡散性が強すぎるため、ペーパーホワイト性には優れるが、液晶層と組み合わせると多重反射が起こって液晶層中に光が閉じ込められて暗かったり、コントラストが低かったりという問題がある。

【0012】また、上記の特開平7-218906号公報に開示されている反射基板を用いたECBモードの液

(3)

3

晶表示装置は、表示特性の最適化が行われていないため、コントラストは高いものの、ペーパーホワイト性が劣るという問題がある。

【0013】本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、コントラスト特性、ペーパーホワイト性に優れた反射型液晶表示装置及び反射板を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置は、一対の基板と、該一対の基板の間に挟持された液晶層と、一枚の偏光板と、反射層とを有する液晶表示装置であって、該反射板と該偏光板とは、該液晶層の異なる側に設けられ、該反射層は、光を反射する面が凹凸を有し、該凹凸の表面に対する接線の傾斜角度が 2° 未満である領域の面積の該基板の面積に対する比率が20%以上60%以下であり、そのことによって、上記目的が達成される。

【0015】該液晶層は、電界効果複屈折モードで駆動されることが好ましい。

【0016】前記凹凸による前記液晶層のリタデーションの差が40nm以下であることが、好ましい。

【0017】前記凹凸による前記液晶層の厚さの差が1 μ m以下であることが、好ましい。

【0018】本発明による反射板は、光を反射するための基板であって、光を反射する面が凹凸を有し、該凹凸に対する接線の傾斜角度が 2° 未満である領域の面積の該基板の面積に対する比率が20%以上60%以下であり、そのことによって上記目的が達成される。

【0019】本発明の反射基板は凹凸を有する反射面を有し、この反射面は、凹凸に対する接線の傾斜角度が 2° 未満である平坦部の面積が基板の面積に対する比率が20%以上60%以下となっている。この平坦部はコントラストの向上に寄与し、凹凸部はペーパーホワイト性の向上に寄与する。その結果、コントラスト特性、ペーパーホワイト性に優れた反射型液晶表示装置を提供できる。

【0020】さらに、凹凸による液晶層のリタデーションの変化分を40nm以下にすることにより、実用的なコントラスト3を達成できるとともに、ECBモードの干渉色を利用して色純度が高いカラー表示を行うことができる。

【0021】また、凹凸による液晶層の厚さの差を1 μ m以下に設定することによって、捻れ角の大きいSTN配向の液晶層を用いても、閾値特性のばらつきによる表示品質の低下のない液晶表示装置を提供することができる。

【0022】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を説明する。

【0023】(ECBモードの反射型液晶表示装置の基

4

本構成)本発明によるECBモードの反射型液晶表示装置(反射型LCD)20の断面図を図2に示す。この実施例では、単純マトリクス駆動されるSTN(スプアーツィスティッドネマティック)型の液晶表示装置について説明する。

【0024】この反射型LCD20は、光の入射側から、偏光板22、位相差板23及び液晶セル20aをこの順で有する。液晶セル20aは、上部基板26と、下部基板(反射基板)25と、上部基板26と下部基板25とに挟持された液晶層24とを有している。上部基板24は、透明基板27と、透明基板27の液晶層24側の面に透明電極28と配向膜29とをこの順で有する。また、下部基板25は、透明基板31の液晶層24側の面に、複数の突起部32と、突起部32を覆う高分子樹脂層33と、反射層34と、配向膜35とをこの順で有する。突起部32は、互いに高さが異なる大突起部32aと小突起部32bとを有している。

【0025】本実施例では、反射層34は、Alで形成されており、電極としても機能する。反射層34と透明電極28は、それぞれストライプ状に配置された電極であり、反射層34と透明電極28とは、液層24を介して互いに直交し、マトリクス状の絵素を形成する。液晶層24としては、STN用の液晶材料(例えば、メルク社製の商品名ZLI4427)を用いる。この反射型LCD20の偏光板22、位相差板23、液晶層24及び反射層34は、それぞれ、図1の偏光板2、位相差板3、液晶層4及び反射板5として機能する。液晶層24として、リタデーションが $\lambda/4$ から0の間で変化する液晶層を用いることによって、位相差板23を省略することができる。位相差板23を設けることによって、反射光の波長分散を低減することができるので、色純度の高い表示が可能となる。また、位相差板23によって、液晶層24の液晶分子の配向に起因する視角依存性を補償することにより、広視野角の表示を提供することができる。

【0026】反射層34の材料は、Alに限られず他の金属材料を用いることもできるし、導電性を有さない反射層を形成する場合には、反射層の上面に透明電極を別途形成してもよい。また、液晶層の配向状態はSTN型に限られず、電界の印加によってリタデーションが変化する液晶層を広く利用することができる。

【0027】次に、図3及び4を参照しながら下部基板25を説明する。図3は下部基板25の上面図である。下部基板25は、透明基板31上に樹脂からなる大突起部31aおよび小突起部31bがそれぞれ多数形成されている。大突起部32aおよび小突起部32bの底部(基板31の表面)における直径D1、D2及び突起部の間隔D3が異なる基板を作製する。D1及びD2は、約3 μ mから20 μ mの範囲にあることが好ましい。約3 μ mよりも小さいとフォトリソグラフィによる加工が

(4)

5

困難となる。また、約 $20\mu\text{m}$ を越えると凸部の高さが高くなり、セル厚に与える影響が大きくなる。D3は、後述する平坦部の面積比率が適切な範囲となるように設定される。例えば、D3をD1及びD2の約 $1/3$ とすることによって、平坦部面積率を約70%にすることができる。なお、後述するように、突起部を熱処理することによって、突起部の直径が大きくなるので、D3の下限値は、フォトリソグラフィによって決まる下限値よりも小さくなり、約 $1.5\mu\text{m}$ となる。

【0028】図4は、下部基板25の製造行程を説明する断面図である。透明基板31としては、厚さ t_1 が、例えば 1.1mm であるガラス基板（コーニング社製、商品名7059）を用いた。図4（a）に示すように、ガラス基板31上に、例として東京応化社製、商品名OFPR800の感光性材料を、 $500\text{r.p.m}\sim 3000\text{r.p.m}$ でスピコートし、樹脂層41を形成する。本実施例では、 2500r.p.m で30秒間スピコートし、厚さ t_2 が、例えば $1.5\mu\text{m}$ の樹脂層41を形成する。

【0029】次に、樹脂層41が成膜された基板を 90°C の雰囲気中で30分焼成し、続いて図4（b）に示すように、大小2種類の円形の遮光部42aが多数形成されたフォトマスク42を配置して露光する。その後、例として東京応化社製、商品名NMD-3の2.38%溶液からなる現像液で現像を行い、図4（c）に示すようにガラス基板31の表面に、高さの異なる大突起41aおよび小突起41bを形成した。この高さの異なる大突起41aおよび小突起41bは、露光時間と現像時間を制御することにより実現できる。

【0030】なお、フォトマスク42は、図3に示す大突起41aおよび小突起41bの配列状態が得られる円形の遮光部42をランダムに配置された構成である。フォトマスク42の遮光部の直径は、大突起41aおよび小突起41bの直径に対応するように設けられている例を図4（b）に示したが、後に説明する図4（d）の熱処理工程における熔融による変形の程度を考慮して、マスクのパターン（D1、D2及びD3）を設定する必要がある。典型的には、熱処理による変形（熱だれ）によって、突起部32aおよび32bの直径D1及びD2は、フォトマスクの遮光部の直径よりも約1から2割程度増加する。また、異なる高さの突起部凸部を、図4（b）に示したように異なる大きさの遮光部42aを有するフォトマスク42を用いて、1つのフォトリソグラフィ工程で、形成しても良いし、それぞれ異なる大きさの遮光部を有する2枚のフォトマスクを用いて、フォトリソグラフィ工程を2回行うことによって、形成してもよい。ここでは、D1＝約 $10\mu\text{m}$ 、D2＝約 $8\mu\text{m}$ 、D3＝約 $2\mu\text{m}$ の場合を示す。

【0031】次に、大突起41aおよび小突起41bが形成されたガラス基板31を 200°C で1時間加熱し、

6

図4（d）に示すように突起41a及び41bの頂部を若干程度熔融して円弧状にし、大突起部32aおよび小突起部32bを形成した。

【0032】次に、この状態のガラス基板31上に、図4（e）に示すように、前記感光性樹脂材料と同一の材料を $1000\text{r.p.m}\sim 3000\text{r.p.m}$ でスピコートする。本実施例では好適な 2000r.p.m でスピコートする。これにより、高分子樹脂層33が、各突起32a、32bの間の凹所を埋め、表面の比較的穏やかでありかつ滑らかな曲面状をしている状態に形成される。本実施例では前記感光性樹脂材料と同一の樹脂を塗布したが、異なる種類のものでもかまわない。なお、高分子樹脂層33の表面に大突起部32aにより形成された、なめらかな大突起の厚み t_4 は約 $1\mu\text{m}$ であり、小突起部32bにより形成された、なめらかな小突起の厚み t_5 は約 $0.3\mu\text{m}$ であった。次に、高分子樹脂層33の上に、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀または金などの金属薄膜を膜厚 t_3 、例えば $0.01\sim 1.0\mu\text{m}$ 程度に形成する。本実施例ではアルミニウムをスパッタリングして、反射層34を形成する。このようにして得られた反射基板60の表面の顕微鏡写真を図6に示す。また、直径約 $10\mu\text{m}$ の円形の遮光部を有するフォトマスクと直径約 $5\mu\text{m}$ の円形の遮光部を有するフォトマスクとを用い、2回のフォトリソグラフィ工程を行うことによって得られた反射基板70の顕微鏡写真を図7に示す。

【0033】なお、上述したように、大突起部32aおよび小突起部32bを平面的にランダムに配置し、さらに大突起部32aおよび小突起部32bの高さを変えることによって、入射光に対して同じ位相差を与える平坦部を少なくできるので、反射層34にて反射された光が干渉して干渉色や縞模様が発生するのを防止することが可能となり、均一で色純度の高い表示を行うことができる。なお、フォトマスク42のパターンは上記の例に限定されず、円形以外の形状でもよい。

【0034】以上のようにして作製された下部基板25と公知の方法で作製された上部基板26とに対し、以下の処理を行う。まず、上部基板26および下部基板25の各々の上に、ポリイミド樹脂からなる配向膜29および35を形成し、 220°C で1時間焼成する。本実施例では、日産化学社製、商品名サンエバー150を用いた。次に、液晶層24の液晶分子を配向させるためのラビング処理を行う。これにより最終的な配向膜29および35が形成される。

【0035】次に、上記ガラス基板31、27間を封止するシール剤を、接着性シール材をスクリーン印刷することによって形成する。

【0036】このようにして形成された下部基板25と上部基板26とを貼り合わせるに際し、下部基板25に直径 $5.5\mu\text{m}$ のスペーサーを散布し、液晶層24の膜

(5)

7

厚の規制を行う。続いて、下部基板25と上部基板26とを対向し、前記シール材（例として直径6 μ mのスペーサーを混入した）で貼り合わせた後、下部基板25と上部基板26との間に、液晶材料を真空注入することにより、液晶層24を形成する。本実施例では、下部基板25と上部基板26との間で240°ツイストしたネマティック液晶（例としてメルク社製、商品名ZLI4427）を用いて、液晶層34を形成する。

【0037】本発明の反射型LCDは、後述するように、反射層33の表面形状が制御されており、優れたペーパーホワイト性とコントラストを有する。以下に、本発明による反射基板（下部基板）の構成について詳細に説明する。

【0038】（反射基板の平坦部の面積）上述した方法を用いて、表面の形状の異なる種々の反射基板を作製した。得られた反射基板を用いて上記反射型液晶表示装置を作製し、コントラストとペーパーホワイト性を評価した。

【0039】反射基板の表面形状を表す指標として、平坦部の面積を用いた。前述したように、鏡面を有する反射板は正反射方向でのみ高いコントラストを実現するが、ペーパーホワイト性に劣る。一方、標準白色板はペーパーホワイト性に優れるが、暗くてコントラストが低い。この反射特性の違いを生じさせる原因が、鏡面反射板と標準白色板との表面形状の違いにあると考え、それらの形状の違いを平坦部の面積率として表すことができると考えた。鏡面は平坦部面積率100%、標準白色板は平坦部面積率0%として表される。

【0040】反射基板の平坦部の面積率の評価方法を図5を参照しながら説明する。図5（a）は反射基板50の表面形状を模式的に示す図であり、図5（b）は、表面プロファイルから求められる傾斜角度 θ を示す図である。なお、反射基板の表面に、A1からなる反射電極が露出されている状態で、以下の観察・評価を行う。

【0041】まず、反射基板50の表面を干渉顕微鏡を用いて観察する。反射基板50の表面の凸部の頂上を通過するように、図5（a）の走査線51に沿って顕微鏡の視野中心を走査することによって、図5（b）に示す*

8

*表面プロファイル52が得られる。図5（b）の横軸は基板面内方向の位置を、縦軸は凹凸の高さをそれぞれ表す。次に、この表面プロファイル52の凹凸に対して接線53を引く。この接線53と基板面（反射基板の2次元の広がり方向によって規定される平面）との成す角を傾斜角 θ と定義する。基板面内方向において、一定間隔 X_0 で、凹凸に対して接線を引き、それぞれ傾斜角 θ を求める。この傾斜角 θ が2°未満の点を平坦部と定義する。傾斜角 θ を測定する点は、典型的には、約0.1 μ m毎（ X_0 =約0.1 μ m）で1つの凸部に対して約100点測定する。傾斜角度 θ の測定は、1絵素全体の表面プロファイルを測定してもよいし、基準的なプロファイルを有する領域を適宜選択し、その領域についてのみ測定してもよい。上述した反射基板の作製方法は、再現性よく凹凸を形成できるので、基準的なプロファイルを有する領域をサンプリングすれば、1絵素全体の表面プロファイルを測定する必要はない。このようにして得られた傾斜角度 θ の測定結果から、傾斜角度 θ が2°未満の測定点の数を全測定点の数で割ることによって、平坦部面積率を算出した。

【0042】図6及び図7に反射基板の具体例を示す。図6（a）及び図7（a）は、反射基板の反射面の光学顕微鏡写真であり、図6（b）及び図7（b）は、それぞれの表面プロファイルの評価した結果を示すヒストグラムである。図6の反射基板60の平坦部面積率（図中のグレーの部分）は約40%で、図7の反射基板70の平坦部面積率（図中の白い部分）は約12%であった。なお、それぞれの顕微鏡写真は、166 μ m \times 256 μ mの絵素の一部を観察した結果である。

【0043】上述のようにして得られた種々の反射基板を用いて、上記の反射型LCD20を作製し、ペーパーホワイト性及びコントラストを評価した結果を表1及び図8にそれぞれ示す。ペーパーホワイト性の評価は複数個の蛍光灯が存在する部屋内において目視で行い、コントラストは垂直入射時のコントラストをパワーメータを用いて評価した。

【0044】

【表1】

平坦部の占有比率	20	40	50	60	80
ペーパーホワイト性	◎	○	○	△	×

◎ 白い
○ 白く感じる
△ 白っぽい
× 金属的（ミラー）な色あい、顔がうつる

} ペーパーホワイト

【0045】表1から明らかなように、平坦部面積率が 50 増加するにつれて、ペーパーホワイト性が低下する。平

(6)

9

平坦部面積率が80%を越えると、観察者の顔が表示面に写るとい現象が見られ、また全体的に暗い印象があった。このことから、平坦部面積率は80%以下、好ましくは60%以下であることが分かる。

【0046】一方、図8から明らかなように、平坦部面積率が高くなるとコントラストは上昇する傾向にある。ペーパーホワイト性に優れている平坦部面積率20%の基板を用いた反射型LCDにおいても、コントラスト4が得られることが分かる。反射型LCDのコントラストは2以上あれば表示が可能で、コントラストが3以上あれば実用的な使用に供せられる。これらの結果から分かるように、平坦部面積率が20~60%の反射基板を用いた反射型LCDは、ペーパーホワイト性に優れるとともに、コントラスト比4以上の高品位の表示を行うことができる。

【0047】(凹凸の高低差とリタデーションとの関係) ECBモードの干渉色を利用したカラー表示装置を構成すると、液晶層のリタデーションのばらつきによって、反射率や色再現性(色純度)が低下するという問題がある。そこで、凹凸(突起部)を有する反射基板において、コントラスト及び色純度の高い表示を得るための条件を検討した。

【0048】図9は反射型LCDを模式的に示す図で、反射基板の表面プロファイル92と液晶層94だけを示*

$$R = \{S_1 / (S_1 + S_2)\} * A^2 \{(\cos \pi(\Delta n d_T / \lambda))^2 - (\sin \pi(\Delta n d_T / \lambda))^2\}^2 + \{S_2 / (S_1 + S_2)\} * A^2 \{(\cos \pi(\Delta n d_B / \lambda))^2 - (\sin \pi(\Delta n d_B / \lambda))^2\}^2$$

【0051】また、液晶層の実効的なリタデーション $\Delta n d_E$ は、下記の(数2)で表される。

【0052】

【数2】

$$\Delta n d_E = \{S_1 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_T + \{S_2 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_B$$

【0053】さらに、凹凸の高低差に起因するリタデー※

$$\Delta n(d_T - d_B) = \{S_1 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_T - \{S_2 / (S_1 + S_2)\} \Delta n d_B$$

【0055】なお、当然のことながら、上述の反射率およびリタデーションを求める方法は、図9(a)に示した表面プロファイル有する反射基板に限られない。図9(b)のように、凸部が高密度に形成された反射基板や、図9(c)のように凸部が低密度で形成された反射基板に対しても適用できる。さらに、反射基板の表面プロファイルの形状も図9に示したものに限られず、種々の形状の表面プロファイルを有する反射基板について、反射率およびリタデーションを求めることができる。例えば、図4(c)に示したような、矩形状の表面プロファイルを有する反射基板に対しても適用できる。

【0056】図4を参照しながら上述した方法で、凹凸の高低差の程度の異なる種々の反射基板を作製し、それらの反射基板を用いて、図2に示した構成のECBモードの反射型液晶表示装置を作製した。得られたECBモ

10

*している。表面プロファイル92は、上述したように、干渉顕微鏡を用いて測定できる。反射基板の表面プロファイル92が凹凸を有するので、液晶層94の厚さは、それぞれ、最小値 d_T (反射基板の凸部の頂点位置に対応)及び最大値 d_B (反射基板の凹部の底点位置に対応)で表される異なる厚さを有する。なお、例えば図9(a)のように、反射基板の表面プロファイル92が高さの異なる凸部を有し、液晶層が厚さ d_{T1} 及び d_{T2} を有する場合は、これらの内の最小値を最小値 d_T とする。このように厚さにばらつきのある液晶層94の実効的なリタデーション及びこのような反射基板を使った反射型LCDの反射率は以下のようにして求められる。

【0049】上述したように、液晶層94の厚さの最小値を d_T 、最大値を d_B とし、凹凸の中間の位置(液晶層94の厚さが $(d_T + d_B) / 2$ となる位置)に補助線95を引き、その補助線95によって2分される面積を求める。補助線95より上にある部分の面積を S_1 、補助線95より下にある部分の面積を S_2 とすると、反射型LCDの反射率 R は、下記の(数1)で表される。以下の数式中、 A は光の振幅、 λ は光の波長、 Δn は液晶分子の複屈折率をそれぞれ表す。

【0050】

【数1】

※シヨンの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ は、下記(数3)で表される(上記(数2)の右辺の2項の差に対応する)。

30 なお、 $(d_T - d_B)$ は、符号を考慮せず、特に断らない限り絶対値を表す。

【0054】

【数3】

ードの反射型LCDについて、(数2)で与えられる実効リタデーション $\Delta n d_E$ と反射率との関係を調べた結果を図10から13に示す。図10から13のグラフにおける横軸は反射型LCDからの反射光の波長で、縦軸は反射率を示す。それぞれ、上記(数2)で表される液晶層の実効リタデーション $\Delta n d_E$ が330nm(図10)、360nm(図11)、470nm(図12)及び530nm(図13)の場合の結果を示す。また、それぞれについて、凹凸の高低差に起因するリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ が0nm(鏡面反射板に相当)、30nm、40nm及び50nmの場合の結果を示す。これらの図に示されるように、液晶層のリタデーションの違いにより、反射率に波長分散(干渉色)が生じる現象を利用することによって、ECBモードのカラー表示装置を構成することができる。

50

(7)

11

【0057】これらの図から明らかなように、液晶層の実効リタデーション値 Δn_{eff} が330nm、360nm、470nm及び530nmの全てにおいて、凹凸の高低差によるリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ が大きくなると、最大透過率(山)が低下し、最低透過率(谷)が上昇する。従って、凹凸の高低差が大きすぎるとコントラストが低下することが分かる。また、凹凸の高低差が大きくなると、反射率の波長依存性(波長分散)の急峻さが低下するので、反射光の色純度が低下することが分かる。

【0058】上述の結果と、凹凸の高低差によるリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ が10nm及び20nmの場合の結果とを合わせて、凹凸の高低差によるリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ の大きさと反射光の波長分散との関係をまとめて、図14に示す。図14は、液晶層の実効リタデーション値が330nm、360nm、470nm及び530nmの場合について、凹凸の高低差に起因するリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ による反射光の波長分散を示す色度図である。凹凸の程度が大きくなるにつれて、全ての波長帯(330、360、470及び530nm)において、反射光の色度が、色度図中央部の白点(波長分散のない状態)に近づいている様子がわかる。このことから、凹凸の高低差が増大すると色純度が低下し、干渉色を利用したカラー表示の色再現性が低下することが分かる。

【0059】また、図15に凹凸の高低差に起因するリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ とコントラストとの関係を示す。図15から明らかなように、凹凸の高低差が大きくなるにつれてコントラストが低下していることが分かる。この図から、実用的なコントラスト3を得るためには、凹凸の高低差に起因するリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ の値が40nm以下であることが必要であり、35nm以下でコントラスト4以上が得られることが分かる。色純度のについても、凹凸の高低差に起因するリタデーションの変化分 $\Delta n(d_T - d_B)$ が40nm以下なら実用上問題なく、35nm以下ならさらに色純度の高い表示を提供することができる。

【0060】(凹凸の高低差と閾値特性との関係)上記実施例で示したECBモードの液晶表示装置で、液晶層のツイスト配向の捻れ角を大きくすると、その電圧-反射率特性における閾値が急峻になる。急峻な閾値特性を有する液晶表示装置においては、液晶層の厚さのばらつきは、閾値電圧のばらつきとなり、表示品質を低下する。

【0061】そこで、液晶層のツイスト配向の捻れ角の大きいSTN型液晶表示装置に適用するための条件を検討した。凹凸の高低差 $|d_T - d_B|$ が、0 μm 、0.5 μm 及び1 μm の反射基板をそれぞれ用いた240°ツイストのSTN型液晶表示装置について、液晶材料の自

12

然ピッチ P_0 とセルギャップ(液晶層の厚さ) d との比(d/P_0)と閾値特性の急峻性 α との関係の評価した結果を図16に示す。

【0062】なお、急峻性 α は、相対反射率が10%に達する電圧値 V_{10} と90%に達する電圧値 V_{90} との比(V_{90}/V_{10})で定義した。

【0063】例えば、反射型LCDを携帯用情報端末機器に適用することを想定すると、1/240のデューティ比で単純マトリクス駆動できる必要があるので、閾値特性の急峻性は、図16中の右下がりの斜線で示した境界領域($\alpha \approx 1.06 \sim 1.07$ の範囲)よりも低い値であることが好ましい。また、液晶分子の安定な配向を得るためには、 d/P_0 は、図16中の左下がりの斜線で示した境界領域(約0.48~0.51の範囲)よりも小さい値であることが好ましい。それは以下の理由による。 d/P_0 が約0.6よりも大きくなると、液晶分子の240°ツイスト配向が不安定となり、ストライプドメインが発生しやすくなり、その結果表示品質が低下する。また、 d/P_0 が約0.42よりも小さくなると、60°ツイスト配向が形成されやすくなるので好ましくない。従って、多少のセル厚ムラがあっても、液晶分子の配向の安定性を考慮すれば、液晶材料の自然ピッチ P_0 とセルギャップ d との比(d/P_0)は約0.48~0.51の範囲にあることが好ましい。

【0064】図16から明らかなように、凹凸の高低差 $|d_T - d_B|$ が大きくなると、急峻性が低下(図16中の上方にずれる)する。従って、急峻性と安定した配向を実現させるためには、凹凸の高低差の程度として、約1 μm 以下、より好ましくは、約0.5 μm 以下であることが分かる。また、図16の点(Δ 、 \circ 及び \bullet)に対応するSTN型液晶表示装置においては、ストライプドメインや60°ツイスト配向は見られなかった。

【0065】なお、上記の閾値特性の問題は、捻れ角の大きいSTN型液晶表示装置において顕著であり、例えば、平行配向モードの液晶表示装置では特に問題とならない。

【0066】

【発明の効果】本発明によれば、ペーパーホワイト性に優れ、且つコントラストの高い反射型液晶表示装置が提供される。さらに、色純度が高く、急峻な閾値特性を有する反射型液晶表示装置が提供される。これらの反射型液晶表示装置は、携帯用情報端末機器をはじめとする電子機器に用いられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ECBモードの反射型液晶表示装置の機能モデル図である。

【図2】本発明によるECBモードの反射型液晶表示装置20の断面図である。

【図3】反射型液晶表示装置20の下部基板25の上面図である。

(8)

13

【図4】反射型液晶表示装置20の下部基板25の製造行程を説明する断面図である。

【図5】反射基板の平坦部面積率の評価方法を示す図である。(a)は、反射基板の表面形状を模式的に示す図であり、(b)は、表面プロファイルから求められる傾斜角度を示す図である。

【図6】反射基板基板を示す図である。(a)は、反射基板の反射面の光学顕微鏡写真であり、(b)は、それぞれの表面プロファイルを評価した結果を示すヒストグラムである。

【図7】反射基板基板を示す図であり、(a)は、反射基板の反射面の光学顕微鏡写真であり、(b)は、それぞれの表面プロファイルを評価した結果を示すヒストグラムである。

【図8】反射型液晶表示装置の平坦部面積率とコントラストとの関係を示す図である。

【図9】反射型液晶表示装置を模式的に示す図である。

【図10】液晶層の実効リタデーションと反射率との関係を示すグラフである。

【図11】液晶層の実効リタデーションと反射率との関係を示すグラフである。

【図12】液晶層の実効リタデーションと反射率との関係を示すグラフである。

【図13】液晶層の実効リタデーションと反射率との関係を示すグラフである。

【図14】凹凸の高低差の異なる反射基板による反射光の波長分散を示す色度図である。

【図15】反射基板の凹凸の高低差とコントラストとの関係を示すグラフである。

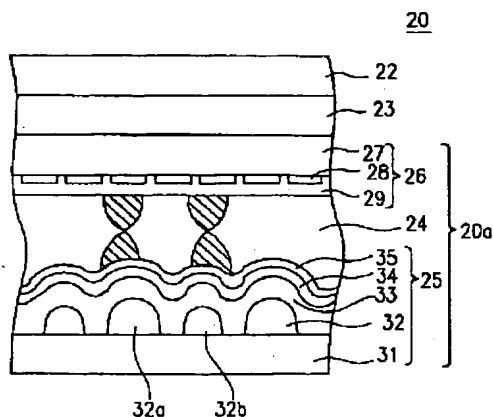
【図16】液晶材料の自然ピッチ P_0 とセルギャップ d との比(d/P_0)と閾値特性の急峻性 α との関係を示す図である。

【符号の説明】

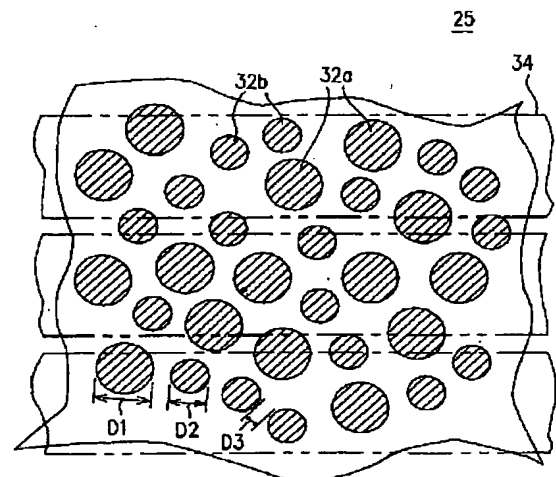
14

- 2 偏光板
- 3 位相差板
- 4 液晶層
- 5 反射板
- 10 ECBモードの反射型液晶表示装置
- 20 反射型LCD
- 20a 液晶セル
- 22 偏光板
- 23 位相差板
- 24 液晶層
- 25 下部基板(反射基板)
- 26 上部基板
- 27 透明基板
- 28 透明電極
- 29、35 配向膜
- 31 透明基板
- 32 突起部
- 32a 大突起部
- 32b 小突起部
- 33 高分子樹脂層
- 34 反射層(反射電極)
- 41 樹脂層
- 41a 大突起
- 41b 小突起
- 42 フォトマスク
- 42a 遮光部
- 50 反射基板
- 51 走査線
- 52 表面プロファイル
- 53 接線
- 92 表面プロファイル
- 94 液晶層
- 95 補助線

【図2】

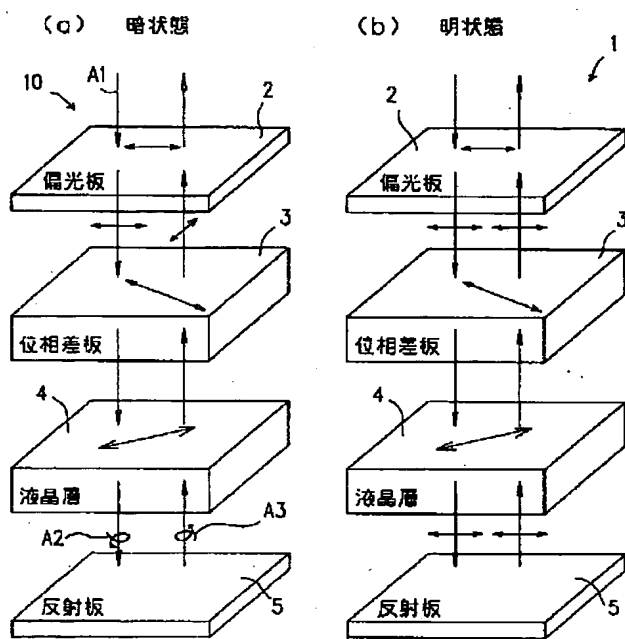


【図3】

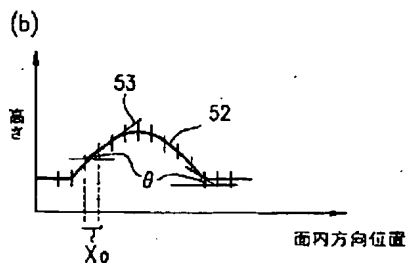
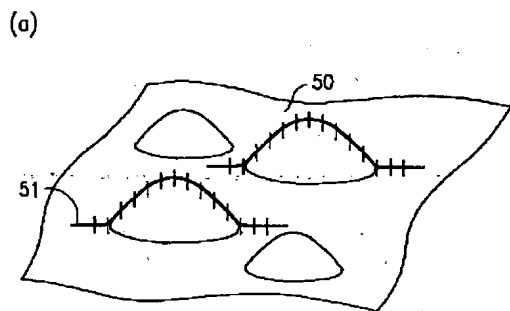


(9)

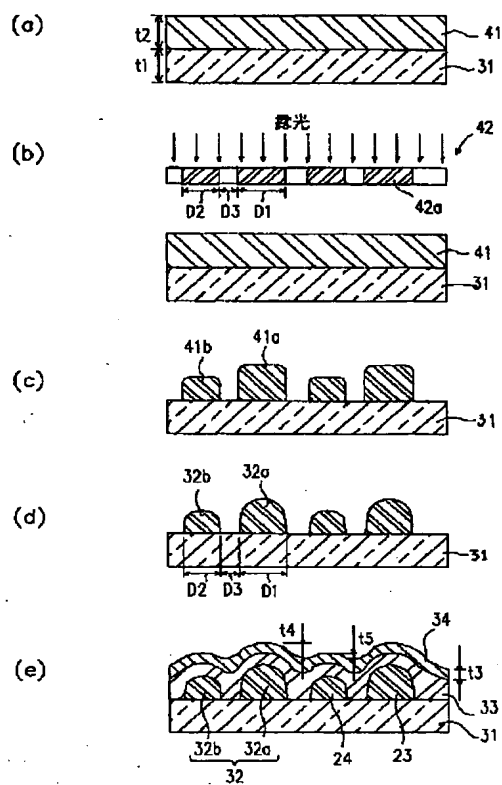
【図1】



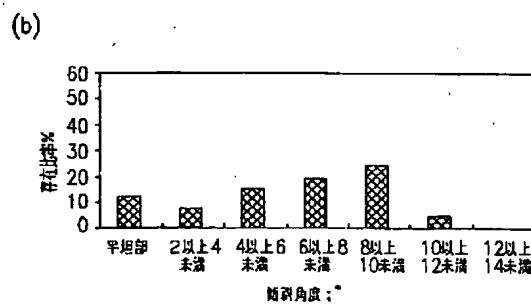
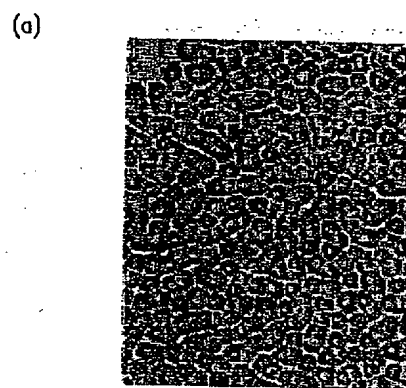
【図5】



【図4】



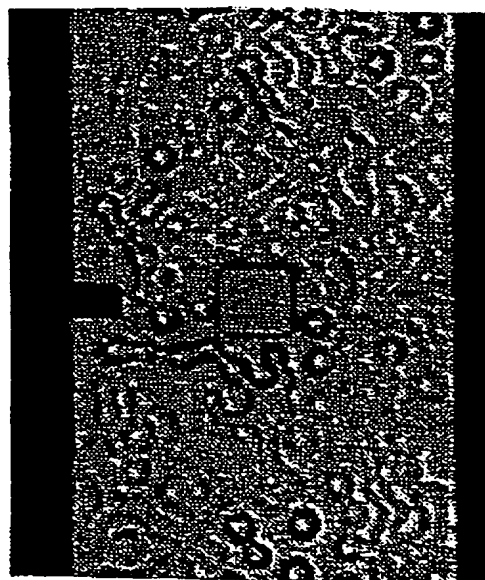
【図7】



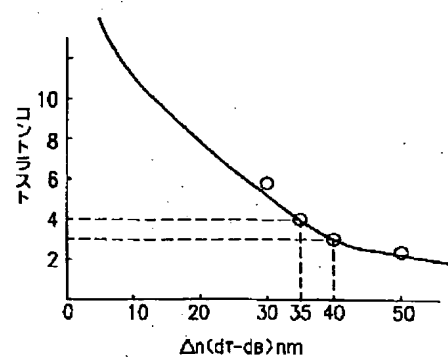
(10)

【図6】

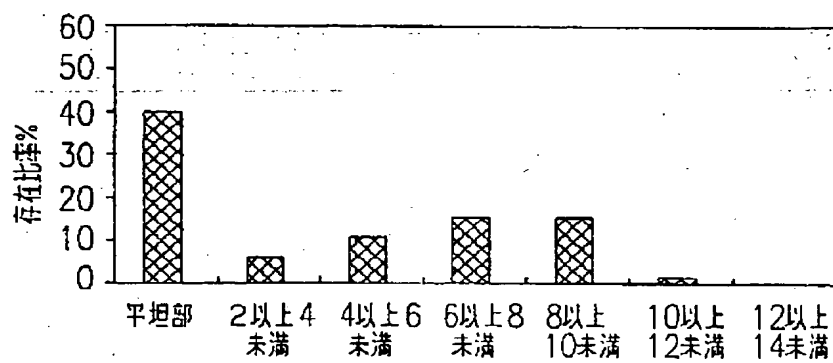
(a)



【図15】

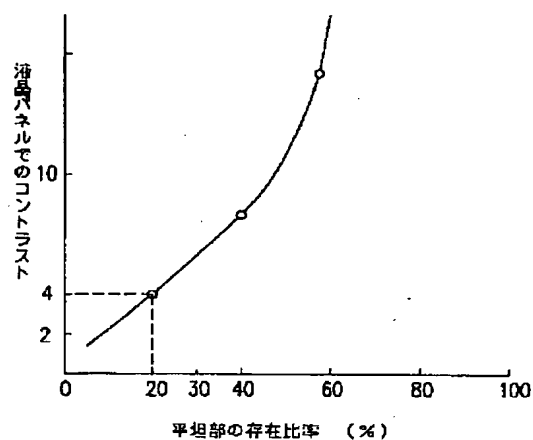


(b)

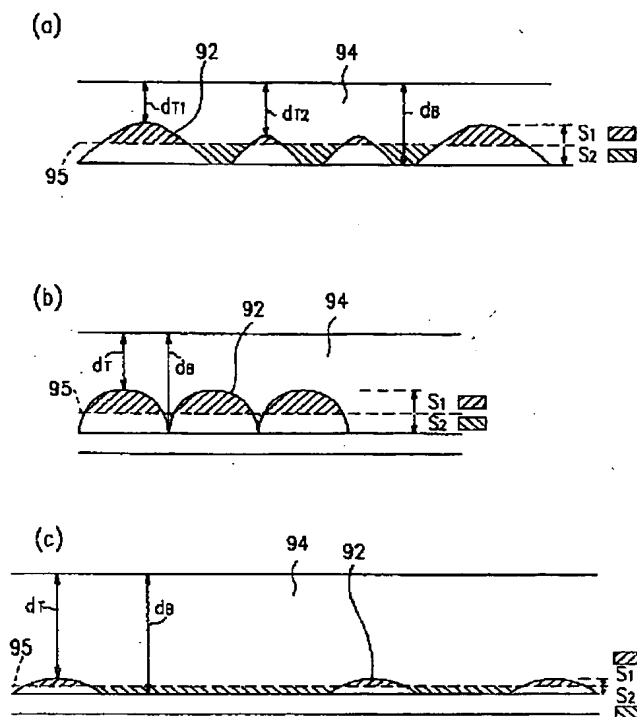


(11)

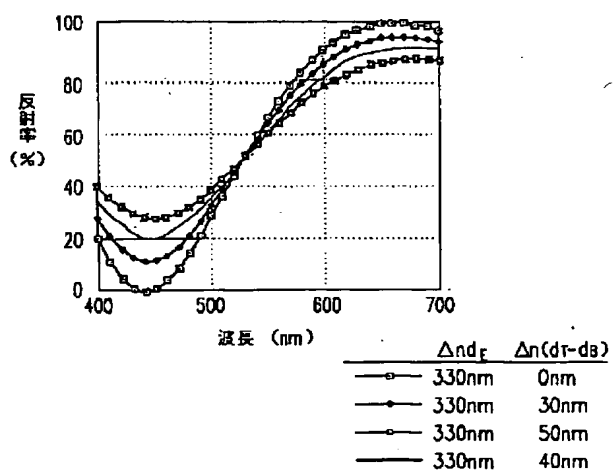
【図8】



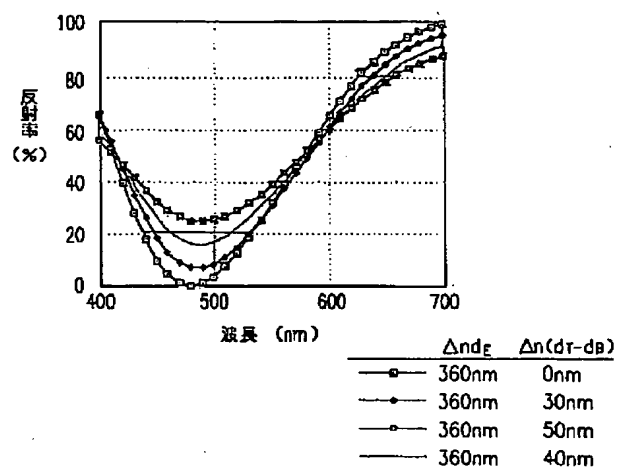
【図9】



【図10】

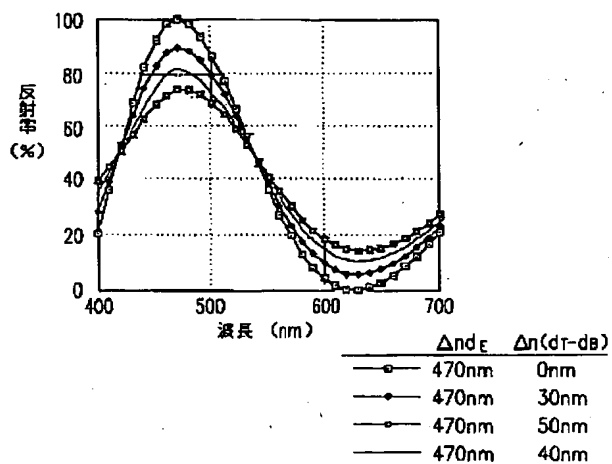


【図11】

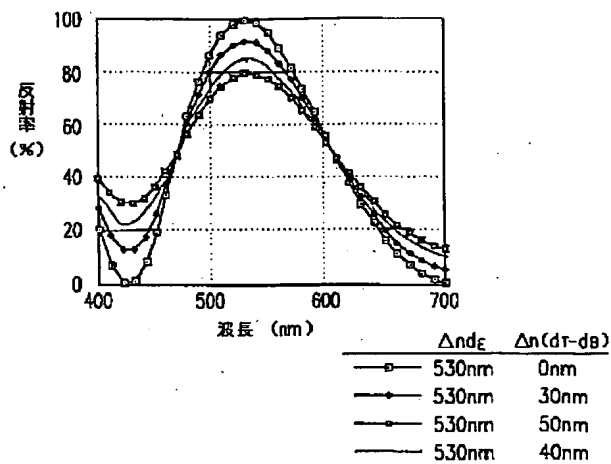


(12)

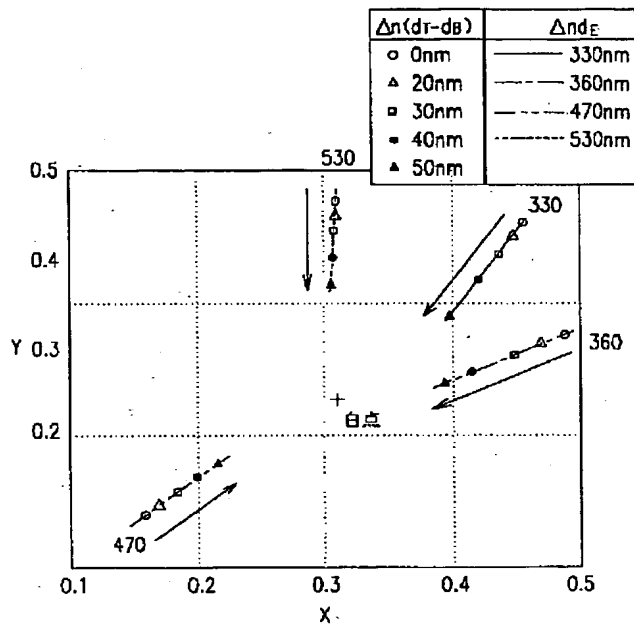
【図12】



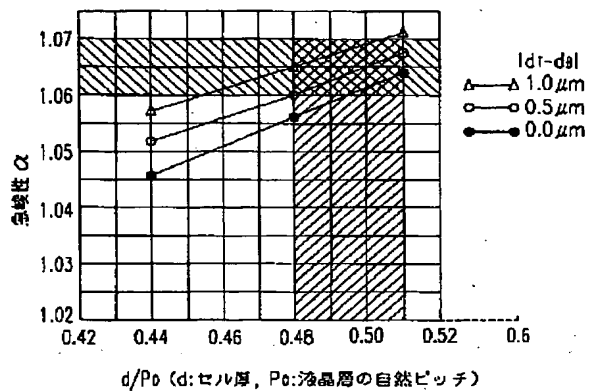
【図13】



【図14】



【図16】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第2区分
【発行日】平成13年1月12日(2001. 1. 12)

【公開番号】特開平6-160856
【公開日】平成6年6月7日(1994. 6. 7)
【年通号数】公開特許公報6-1609
【出願番号】特願平4-306891
【国際特許分類第7版】
G02F 1/1337
【FI】
G02F 1/1337

【手続補正書】

【提出日】平成11年11月12日(1999. 11. 12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】

【請求項1】対向する一対の基板の間に液晶層を封入したマトリックス液晶表示素子であって、前記一対の基板のうち一方の基板上に設けられた複数の電極と対向する他方の基板上に設けられた電極とにより明暗の制御が行われる複数の画素が構成され、前記一対の基板のうちの少なくとも一方の基板の配向膜面を、前記画素の配列ピッチの2倍未満のピッチをもつ断面波状の凹凸面としたことを特徴とする液晶表示素子。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0002
【補正方法】変更
【補正内容】
【0002】

【従来の技術】画像を表示するマトリックス液晶表示素子として、その両側に配置する一対の偏光板の透過軸の方向を、液晶分子がツイスト配列状態にあるときは透過光が出射側偏光板で遮断され、液晶分子を電界の印加によって立上り配列させたときは透過光が出射側偏光板を透過して出射するように明暗の制御を行う、いわゆるネガ表示方式のものがある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示素子は、一対の基板のうち一方の基板上に設けられた複数の電極と対向する他方の基板上に設けられた電極とにより明暗の制御が行われる複数の画素が構成され、前記一対の基板のうちの少なくとも一方の基板の配向膜面を、前記画素の配列ピッチの2倍未満のピッチをもつ断面波状の凹凸面としたことを特徴とするものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正内容】

【0024】この液晶表示素子は、その一方の基板(下基板)12の配向膜16の膜面を、画素配列ピッチ P_0 の2倍未満のピッチ P をもつ断面正弦波状の凹凸面とすることにより、液晶層の層厚を増減させて、リタデーション $\Delta n \cdot d$ の値を連続的に異ならせたものであり、この実施例では、使用する液晶17の屈折率異方性 Δn に応じて前記最小の液晶層厚 d_1 と最大の液晶層厚 d_2 とを設定し、最小リタデーション(最小液晶層厚 d_1 部分のリタデーション) $\Delta n \cdot d_1$ から最大リタデーション(最大液晶層厚 d_2 部分のリタデーション) $\Delta n \cdot d_2$ までのリタデーション値を、 $1.00 \sim 1.50 \mu\text{m}$ の範囲で連続的に異ならせている。